**Nazwa przedmiotu:**

Technologia sprzętu optoelektronicznego

**Koordynator przedmiotu:**

dr inż. Michał Józwik, adiunkt

**Status przedmiotu:**

Obowiązkowy

**Poziom kształcenia:**

Studia I stopnia

**Program:**

Mechatronika

**Grupa przedmiotów:**

Obowiązkowe

**Kod przedmiotu:**

**Semestr nominalny:**

6 / rok ak. 2009/2010

**Liczba punktów ECTS:**

3

**Liczba godzin pracy studenta związanych z osiągnięciem efektów uczenia się:**

**Liczba punktów ECTS na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:**

**Język prowadzenia zajęć:**

polski

**Liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:**

**Formy zajęć i ich wymiar w semestrze:**

|  |  |
| --- | --- |
| Wykład: | 15h |
| Ćwiczenia: | 0h |
| Laboratorium: | 0h |
| Projekt: | 15h |
| Lekcje komputerowe: | 0h |

**Wymagania wstępne:**

Materiałoznawstwo, technologia przyrządów precyzyjnych, optomechatronika, grafika inżynierska, mechanika ogólna

**Limit liczby studentów:**

**Cel przedmiotu:**

Poznanie podstawowych procesów technologicznych, metod kształtowania i pomiaru elementów optycznych oraz rozwiązań konstrukcyjnych podstawowych urządzeń optoelektronicznych. Umiejętność wykonania dokumentacji procesu technologicznego.

**Treści kształcenia:**

(W): Specyfika wymagań i warunki eksploatacji sprzętu optycznego – elektronicznego. Wprowadzenie Specyfika wymagań technologicznych dla elementów optycznych i elektronicznych. Ogólna struktura procesów technologicznych. Wybór metody obróbki powierzchni w zależności od materiału i właściwości elementu. Optymalizacja i wymagania technik wytwarzania. Warunki eksploatacji, parametry użytkowe i kryteria wyboru rozwiązań konstrukcyjnych sprzętu optycznego i elektronicznego. Typowe procesy technologiczne elementów optycznych. Podstawowe operacje obróbki mechanicznej: frezowanie, toczenie diamentowe, szlifowanie, docieranie, polerowanie, centrowanie. Techniki obróbki laserowej i technologie specjalne. Typowe procesy technologiczne elementów półprzewodnikowych. Wytwarzanie i przygotowanie krzemowych podłoży mikroelektroniki, światłowodów i krystalicznych elementów laserowych. Epitaksja, dyfuzja, technika maskowania, mikrolitografia, warstwy tlenkowe i azotkowe, mikromontaż, hermetyzacja. Techniki produkcji światłowodów i struktur światłowodowych. Technologia produkcji światłowodów i falowodów planarnych. Technologia przetworników obrazu. Wytwarzanie matryc CCD, luminoforów i technologia ciekłych kryształów. Optyczne powłoki cienkowarstwowe. Techniki nanoszenia warstw i ich zastosowania. Systemy komputerowego wspomagania CAx. Systemy komputerowego wspomagania wytwarzania CAM. Systemy komputerowego wspomagania projektowania materiałowego CAMD.
(P): Dokumentacja procesu technologicznego elementu optycznego.
Zadanie w postaci przygotowania dokumentacji procesu technologicznego wybranego elementu optycznego. Projekt zawiera samodzielny wybór i przedstawienie kolejności operacji technologicznych, maszyn obróbczych, narzędzi i pomocy oraz ich oznaczeń na podstawie norm oraz danych katalogowych. Przewidywana realizacja jednego procesu technologicznego w warsztacie optycznym.

**Metody oceny:**

(W) Zaliczenie
(P) Ocena projektu

**Egzamin:**

**Literatura:**

1. A. Szwedowski, Materiałoznawstwo optyczne i optoelektroniczne, WNT, Warszawa 1996
2. Z. Legun, Technologia elementów optycznych, WNT, Warszawa 1982
3. A. Szwedowski, A. Wojtaszewski, Technologia elementów optycznych. Pomiary optyczne, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1994
4. L. A. Dobrzański, Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, WNT, Warszawa 2006
5. Normy ISO i strony www

**Witryna www przedmiotu:**

**Uwagi:**

## Efekty przedmiotowe